



ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА ГЛУБОКОГО АНИЗОТРОПНОГО ТРАВЛЕНИЯ

МВУ ТМ ПЛАЗМА 06

Назначение:

Глубинное анизотропное травление кремниевых пластин.

- Рабочая поверхность стола-ВЧ электрода $\varnothing 180$ мм;
- Измерение ВЧ смещения на ВЧ электроде – подложкодержателе в диапазоне от 0 до 1000 В;
- Регулирование и автоматическое поддержание уровня мощности ВЧ электрода-подложкодержателя в диапазоне 30-200 Вт;
- Рабочие газы: Ar , SF_6 , O_2 , C_4F_8 ;
- Регулирование и автоматическое поддержание уровня мощности ВЧ ICP источника плазмы в диапазоне 400-600 Вт;
- Безмасляная система откачки (ТМН300);
- Микропроцессорная система управления;
- Мощность потребления не более 3 кВт;
- Площадь, занимаемая одной установкой $\sim 2,5$ м².

